

「貴金属薄膜・微粒子の合成プロセス」

共催：CVD 研究会

開催主旨

貴金属の利用は、装飾品にはじまり、触媒として化学プロセスにもちこまれ、その後、自動車用触媒、電子機器の配線・電極材へと応用範囲が広がった。今後も、固体高分子形燃料電池の電極触媒、太陽電池の電極材、各種プリンティッドデバイス用の導電性ペースト、色素増感型太陽電池の色素など、様々な新しい用途に利用されていきます。この多様性の存在は、様々な製造法を用いた種々の形態で貴金属が利用されていることを意味しています。一方、貴金属は稀少かつ高価であることから、高効率な製造、長期安定性の向上、回収・再利用といったことを考慮に入れた製造プロセスを検討することが重要です。そこで本シンポジウムにおいては、貴金属市場動向から新規貴金属原料、電子材料応用、触媒に関する最新のトピックスまでのご講演をいただき、貴金属合成プロセスについて議論する機会を企画しました。貴金属薄膜・微粒子の製造・応用について理解を深める機会になると幸いです。多数のご参加をお待ち申し上げます。

日時：2012年11月21日（水）13:00～17:45

場所：日本工業大学 神田キャンパス 3階多目的ホール

<http://mot.nit.ac.jp/access.html>

最寄駅：神保町駅（半蔵門線，三田線，新宿線）A1 または A6 出口徒歩2分
九段下駅（半蔵門線，東西線，新宿線）5 または 6 番出口徒歩6分

参加費：

化学工学会反応工学部会 CVD 反応分科会個人会員（2,000 円），同法人会員（無料），
反応工学部会会員（3,000 円），化学工学会会員（4,000 円），CVD 研究会会員（4,000
円），非会員（10,000 円），学生（無料）

申込方法：

(1)氏名，(2)勤務先，(3)連絡先 E-mail，(4)参加資格（所属学会等）を明記の上，電子メールにて cvd@scej.org までお申込み下さい。

申込締切：11月16日（金）ただし，定員（70名）になり次第締め切ります。

プログラム

12:30 受付開始

13:00～13:05 開会挨拶

13:05～13:50 「貴金属市場動向と新規貴金属プリカーサの開発」

（田中貴金属）齋藤昌幸 氏

- 13:50~14:35 「Cu 配線向け CVD Ru ライナーの成膜技術」
 (東京エレクトロン) 石坂忠大 氏
- 14:35~15:20 「CVD Co プロセスの応用」
 (アルバック) 牛川治憲 氏
- 15:20~15:40 Coffee Break
- 15:40~16:25 「ULSI-Cu 配線用 Co(W)薄膜形成プロセスの開発と Ru との比較」
 (大陽日酸) 清水秀治 氏
- 16:25~16:55 「ホローカソード CVD を用いたオスミウムコーターの開発」
 (真空デバイス) 平野修司 氏
- 16:55~17:45 「金ナノ粒子の調製方法と触媒特性」 (首都大学東京) 春田正毅 氏

問い合わせ先

化学工学会反応工学部会 CVD 反応分科会 <http://www2.scej.org/cre/cvd/>

京都大学 河瀬元明 (kawase@cheme.kyoto-u.ac.jp)

大阪府立大学 齊藤丈靖 (tsaito@chemeng.osakafu-u.ac.jp)

気相成長 (株) 町田英明 (machida@kisoh-seicho.com)



会場 (日本工業大学神田キャンパス (専門職大学院)) 案内図